

## 令和3年度 ナノテクキャリアアップアライアンス 京都大学 電子線描画装置 アドバンストコース

### ■ 目的：

近年、微細加工技術で大いに注目を集めているのが MEMS・NEMS 技術であり、既に様々な分野で研究・開発・実用化が進んでいます。特に、センサ・情報通信・医療・バイオなどの分野で著しい発展をとげています。この技術の中で、微細構造作製におけるキープロセスのひとつが、電子線描画です。

本コースにおいては、微細加工の中級者を対象にし、最新鋭電子線描画装置を使用した Si ウェハへの高度な描画(多層レジスト、重ね合わせ描画等)をメインに、より複雑なデバイス加工に対応した微細加工のための基本技術の習得を目指します。

### ■ 募集人数：

3 名

### ■ 期間：

令和 4 年 3 月 7 日 (月) ~ 3 月 9 日 (水)  
( 座学: 0.5 日間、実習: 2 日間 計 2.5 日間 )

### ■ 会場：

京都大学 ナノテクノロジーハブ拠点  
京都市左京区吉田本町 京都大学吉田キャンパス 工学部物理系校舎3階327号  
URL: <http://www.nanoplat.cpier.kyoto-u.ac.jp/access/>

### ■ 内容：

1日目： 3月7日(月) 午後

- ① 電子線描画の基礎から応用(座学)  
(電子線描画の概要、装置、描画方式、プロセス、位置合わせ、近接効果補正 等)

2日目： 3月8日(火)

- ② CAD による描画パターンデータ作成
- ③ 露光前処理 -レジスト塗布等(実習)
- ④ 多層レジストを用いた描画(実習)

3日目： 3月9日(水)

- ⑤ 金属蒸着(実習)
- ⑥ 描画パターンの SEM 観察(実習)

### ■ 受講料：

14,000円

### ■ 問合せ・申込先：

京都大学 CUPAL 事務局  
京都市西京区京都大学桂C3棟  
京都大学工学研究科 ナノ・マイクロシステム工学研究室内(担当:河野)  
TEL: 075-383-3693  
E-mail: [cupal@nms.me.kyoto-u.ac.jp](mailto:cupal@nms.me.kyoto-u.ac.jp)